This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP403152705A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03152705 A

TITLE:

MAGNETIC HEAD

PUBN-DATE:

June 28, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME OGURA, TAKASHI SHIMIZU, YOSHIAKI OKUDA, HIROYUKI YAMANO, TAKAO INO, KAZUO ISHIHARA, KOZO SHIMIZU, TSUKASA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SANYO ELECTRIC CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01290227

APPL-DATE:

November 8, 1989

INT-CL (IPC): G11B005/23

US-CL-CURRENT: 360/119

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent deterioration in self recording and reproducing characteristic at a high frequency band by providing an inplane magnetic anisotropy that a magnetiza tion easy axis direction is directed in the track width direction of an operating gap to a ferromagnetic metallic thin film in the vicinity of the operating gap.

CONSTITUTION: Ferromagnetic metallic thin films 7, 7 adhered in the vicinity of an operating gap 2 of magnetic core halves 1 1' have an inplane magnetic anisotropy that a magnetization easy axis direction is directed in the track width direction (arrow A) of an operating gap 2. At first, a deformed layer is removed and a film forming background face is formed by applying chemical etching and reverse sputtering with a phosphoric acid solution or the like to the upper face of a base 8 made of a ferromag netic oxide such as an Mn-Zn ferrite subjected to mirror surface grinding, a heat resistance oxide thin film made of SiO<SB>2</SB> or the like acting like a diffusion suppression layer is adhered to the film forming background by means of the sputtering or the like and the ferromagnetic metallic thin film 7 and a nonmagnetic thin film 9 being a gap spacer are adhered onto the heat resistant oxide thin film by the sputtering or the like. Thus, the head with excellent recording and reproducing characteristic at a high frequency band is realized.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-152705

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月28日

G 11 B 5/23

K

6789-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

ᡚ発明の名称 磁気ヘッド

②符 願 平1-290227

②出 願 平1(1989)11月8日

@発 明 者 小 食 隆 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 **@発明** 者 凊 水 昭 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 良 個発 明 者 裕二 奥 田 之 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 @発 明 者 ш 野 老 雄 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 @発 明 者 伊 夫 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 野 饱発 明 者 Ξ 原 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 石 個発 明 者 一 三 清 水 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 三洋電機株式会社 ⑪出 願 人 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 個代 理 人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

磁 気 ヘッド

2. 特許額求の範囲

(1) 作動ギャップ近傍に強磁性金属薄膜を有する磁気ヘッドにおいて、前記強磁性金属薄膜は 磁化容易軸方向が前記作動ギャップのトラック幅 方向を向く面内磁気異方性を有することを特徴と する磁気ヘッド。

3. 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明はVTR(ビデオテープレコーダ)、DAT(デジタルオーディオテープレコーダ)等の磁気記録再生装置に使用される磁気ヘッドに関し、特に磁気コアの作動ギャップ近傍に強磁性金属障膜が被着形成されている複合型の磁気ヘッドに関する。

- (ロ) 従来の技術

近年、VTR、DAT等の磁気記録再生装置に おいては、記録信号の高密度化が進められてお り、この高密度記録に対応して、磁性粉として下e、Co、Ni等の強磁性金属粉末を用いた抗磁力の高いメタルテープが使用されるようになっている。例えば、8ミリピデオと称する小型のVTRではHc=1400~1500エルステッド程度の高い抗磁力を有するメタルテープが用いられる。その理由は、磁気記録再生装置を小型化するために記録密度を高める必要性から、信号の記録波長を短くすることの可能な記録媒体が要求されてきたためである。

一方、このメタルテープに記録するために従来のフェライトのみからなる磁気へッドを用いると、フェライトの飽和磁東密度が高々5500がウス程度であることから磁気飽和現象が発生するため、メタルテープの性能を充分に活用することができない。そこで、この高い抗磁力を有するメタルテープに対応する磁気へッドとしては、通常、磁気へッドとして要求される磁気コアのギャップ近傍部の飽和磁東密度が大きいことが要求される。この

要求を適たすメタルテーブ対応型の磁気ヘッドとしては、特開昭60-229210号公報(G1185/187)等に開示されているような磁気飽和現象の最も生じやすい作動ギャップ近傍部分を、磁気コアとして使用されるフェライトよりも飽和磁化の大きな金属磁性材料(たとえば、パーマロイ、センダスト、アモルファス磁性体)で構成した磁気ヘッド(複合型の磁気ヘッドと称する)が提案されている。この複合型の磁気ヘッドは信頼性、磁気特性、耐摩耗性等の点で優れた特性を有する。

第12図は複合型の磁気ヘッドの外観を示す斜視 図である。

図中、(1)(1')はMn-2nフェライト等の 強磁性酸化物よりなる一対の磁気コア半体、(2) は作動ギャップであり、前記磁気コア半体(1) (1')の作動ギャップ(2)近傍にはセンダスト等 の強磁性金属薄膜(3)(3)が破着形成されてい る。(4)は巻線溝、(5)は前記磁気コア半体(1) (1')を結合するためのガラスである。

上記磁気ヘッドの製造方法において、前記強磁

に磁化容易軸方向が向いている面内磁気異方性を 有することを特徴とする。

(ホ) 作用

上記構成に依れば、高周波領域での自己記録再、 生特性の劣化が抑えられる。

(へ) 実施例

以下、図面を参照しつつ本発明の一実施例を詳細に説明する。

第1図は本実施例の磁気ヘッドの外観を示す斜 視図、第2図は上記磁気ヘッドの要部破断斜視図 であり、第12図と同一部分には同一符号を付しそ の説明を割受する。

本実施例の磁気ヘッドでは、磁気コア半体(1) (1)の作動ギャップ(2)近傍に被着形成された 強磁性金属再膜(7)(7)は、作動ギャップ(2)の トラック幅方向(矢印 A 方向)に磁化容易 方向が 向いている面内磁気異方性を有している。

次に、上記本実施例の磁気へッドの製造方法に ついて説明する。

先ず、第3図に示すように鏡面研磨されたMn

しかし乍ら、上述の方法でセンダスト等の強磁 性金属薄膜を形成した場合、前記強磁性金属薄膜 内に面内磁気異方性が誘導される。そして、この 面内磁気異方性により前記強磁性金属薄膜の磁気 特性は劣化し、更には磁気ヘッドの記録再生特性 が悪化する。

(ハ) 発明が解決しようとする課題

本発明は上記従来例の欠点に鑑み為されたもの であり、強磁性金属再膜内の面内磁気異方性によ り記録再生特性が悪化するのを防止した磁気へッ ドを提供することを目的とするものである。

(二) 課題を解決するための手段

本発明の磁気へッドでは、作動ギャップ近傍の 強磁性金属薄膜が作動ギャップのトラック幅方向

- 2 nフェライト等の強磁性酸化物よりなる基板 (8)の上面にリン酸溶液等によりケミカルエッチング及び逆スパッタリングを行うことにより加工 変質層を除去して成膜下地面を形成した後、鎮皮膜下地面上に拡散抑制層として働く SiO。等よりなる耐熱性酸化物 専膜(図示せず)をスパッタリング等により被着形成し、その後鎮耐熱性酸化物 専膜上に 5 μπ厚の強磁性金風薄膜(7)及びギャップスペーサとなる SiO。等よりなる非磁性 専院(9)をスパッタリング等により被着形成する。本 鎮強 磁性金属薄膜(7)の磁化容易軸方向が第3 図中の 矢印 C 方向を向くように行う。

第7図は対向ターゲット式スパッタリング装置の概略図である。図中、(10)(10)はターゲット、(11)は基板ホルダー、(12)は基板である。第9図は上記スパッタリング装置を用いて基板(12)上に形成されたセンダストよりなる強磁性金属薄膜のヒステリシス曲線であり、曲線イは第7図のX軸方向におけるB-Hカーブ、曲線ロは第7図のY

帕方向におけるB-Hカーブである。この第9図から判るように上述の対向ターゲット式スパッタリング装置で形成された強磁性金属専膜の面内磁気異方性は磁化容易帕方向がX帕方向を向いている。即ち、第7図の対向ターゲット式スパッタリング装置を用いて本実施例の強磁性金属専膜(7)を形成する場合、第3図の矢印C方向がX軸方向と一致するように基板(8)を配置すればよい。

また、第8図は回転基板を用いた2個スパッタリング装置の機略図である。図中、(13)はターゲット、(14)は矢印D方向に回転する基板ホルダー、(15)は基板である。この2個スパッタリング装置においても上述と同様に強強性金属再膜のヒステリシス血線を測定し、面内磁気異方性を調べた。その結果、上述の2個スパッタリング装置で形成された強強性金属再膜の面内磁気異方性は、磁化容易軸方向が第3図におけるX軸方向を向いていることが判明した。

次に、本実施例の製造方法では、第4図に示す ように所定の形状のフォトマスクを用いてレジス

合面同士が衝き合う状態でガラス接合してブロックを形成し、その後前記ブロックに研摩、切断等の加工を施すことにより本実施例の磁気ヘッドが 複数個形成される。

また、比較例1として、第1図に示す構造の磁気へッドにおいて、磁化容易軸方向が作動ギャップ(2)のトラック幅方向と直交する方向(第2図の矢印B方向)に向いている強磁性金属薄膜を有する磁気へッドを形成した。更に、比較例2として、面内等方性の強磁性金属薄膜を有する磁気へッドを形成した。

第10図は本実施例と比較例1,2との夫々の世 気ヘッドにおいて、0.5~10MHzのスイープ信号 を記録再生した際の再生出力値を示す図である。 尚、この時の使用テープはメタルテープ、磁気 ヘッドのドラック幅は20gm、テープ・ヘッド間の 相対速度は3.8m/sである。

第10図から判るように、本実施例の磁気ヘッド と比較例1の磁気ヘッドとを比較すると、約2M Hiまでの低周波領域では比較例1の磁気ヘッド ト(16)のパターンを形成する。第4図において、(17)はギャップ形成予定部分、(18)は巻線溝形成予定部分、(19)はガラス棒棒入溝形成予定部分である。前記ギャップ形成予定部分(17)は矢印C方向がトラック幅方向となる。即ち、前記ギャップ形成予定部分(17)のトラック幅方向は、X軸方向である強磁性金属膵膜(7)の磁化容易軸方向と一致する。

次に、第5図に示すようにイオンピームエッチングにより前記レジスト(16)形成部以外の不要の非母性階膜及び強母性金属環膜を除去して基板(8)を露出させ、所定のパターン(ギャップ衝き合わせ部)の強磁性金属薄膜(7)及び非磁性薄膜(9)を見す。

次に、第6図に示すように前記基板(8)の上面 露出部に回転砥石等により溝加工を施してガラス 充填溝(20)を形成する。

以後、周知の如く第6図に示す基板(8)を一対 用意し、そのうち一方の基板に巻線溝及びガラス 棒挿入溝を形成した後、前記両基板をギャップ衝

の方が若干高出力が得られるが、それ以上の高周 波領域では本実施例の磁気へッドの方が高出力が 得られる。また、本実施例の磁気へッドと比較例 2の磁気へッドとを比較した場合においても、 約5 M H : までの低周波領域では比較例2の磁気 ヘッドの方が高出力が得られるが、それ以上の高 周波領域では本実施例の磁気ヘッドの方が高出力 が得られる。

以上のように、本実施例の磁気ヘッドは、高周 被領域での記録再生特性に優れ、且つ量産性に適 した回転基板を用いた 2 極スパッタリング法、対 向ターゲット式スパッタリング法等により容易に 製造することが出来る。

尚、本発明は上述の実施例以外にも、第11図(a)(b)(c)に夫々示すような構造の磁気ヘッドにおいても適用可能である。

(ト) 発明の効果

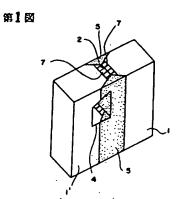
本発明に依れば、高周波領域での記録再生特性 に優れ、且つ量産性に適した構造の磁気ヘッドを 提供し得る。

4. 図面の簡単な説明

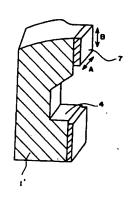
第1図乃至第11図は本発明に係り、第1図は曲 気ヘッドの外観を示す斜視図、第2図は磁気ヘッ ドの要部破断斜視図、第3図、第4図、第5図及 び第6図は夫々磁気ヘッドの製造方法を示す斜視 図、第7図及び第8図は夫々スパッタリング装置 の概略を示す図、第9図はヒステリシスループを 示す図、第10図は自己記録再生出力の周波数特性 を示す図、第11図は他の実施例の磁気ヘッドの外 観を示す斜視図である。第12図は従来の磁気ヘッ ドの外観を示す斜視図である。

(2)…作動ギャップ、(7)… 強磁性金属薄膜。

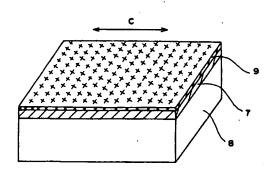
出願人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名)



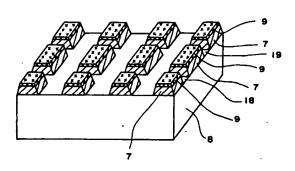
第2図



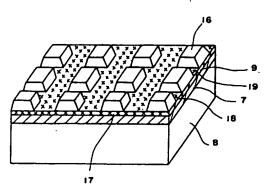
第3図



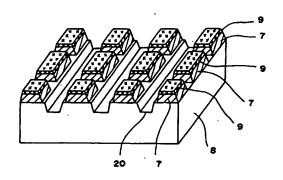
第5図



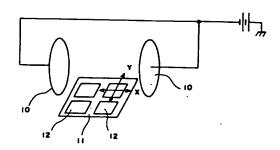
第4図



第6図

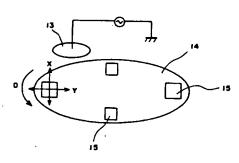


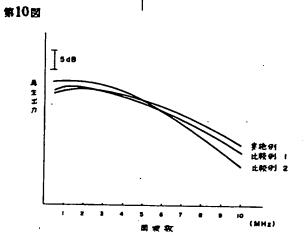
第7図



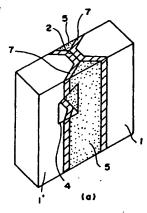
第9図

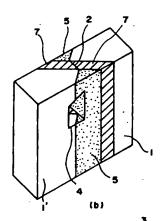
第8図

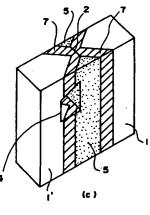




第11図







第12図

